

Small sputtering equipment

小型スパッタ装置

Small sputtering equipment for R&D and Production

研究開発装置 EB1000 / 生産装置 EB1100 EC7000

- **小型・低価格**
Compact and low cost
- **多層成膜に対応**
Multi-layer deposition
- **簡単操作**
Easy operation
- **高い拡張性**
High expandability

生産装置

Sputtering equipment for production



研究開発・生産装置

Sputtering equipment for R&D and production

EC7000



EB1100

研究開発

Sputtering equipment for R&D



EB1000

多様なニーズに充実の
ラインナップで応えます。

Applicable for various needs with
abundant option

CANON ANELVA CORPORATION

Enabling nano level micro fabrication by ultra-high vacuum

超高真空が実現するナノレベルの微細加工

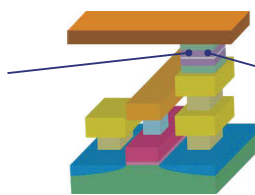
CANON ANELVA Equipment solution

キャノンアネルバの装置ソリューション

Non-Volatile Memory



NC8000 / EC8000
ドライエッチング装置
NC8000 / EC8000
Dry Etching Equipment



NC7900 / EC7800
スパッタリング装置
NC7900 / EC7800
Sputtering Equipment

RF Filter Device



EC7420
スパッタリング装置
EC7420
Sputtering Equipment



EC7400
スパッタリング装置
EC7400
Sputtering Equipment



EC7430
スパッタリング装置
EC7430
Sputtering Equipment

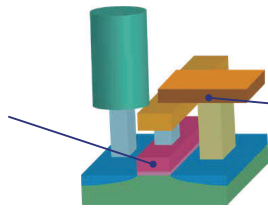


BC7000
原子拡散接合装置
BC7000 Atomic Diffusion
Bonding Equipment

DRAM



FC7100
スパッタリング装置
FC7100
Sputtering Equipment



IC7200 / IC7500
スパッタリング装置
IC7200 / IC7500
Sputtering Equipment

HDD



ML3000シリーズ
スパッタリング装置
ML3000 Series
Sputtering Equipment

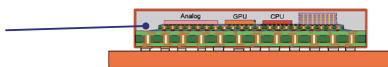


HC7100 / HC7300
スパッタリング装置
HC7100 / HC7300
Sputtering Equipment

Advanced Packaging



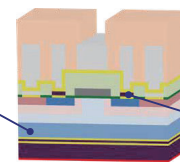
EL3400
スパッタリング装置
EL3400
Sputtering Equipment



Power Device



BC7000
原子拡散接合装置
BC7000 Atomic Diffusion
Bonding Equipment

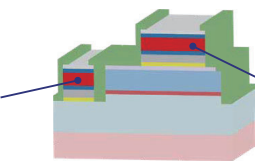


IC1060
スパッタリング装置
IC1060
Sputtering Equipment

LED



EL3000シリーズ
スパッタリング装置
EL3000 Series
Sputtering Equipment

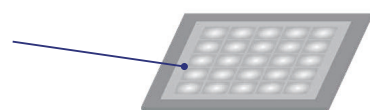


EC8100
スパッタリング装置
EC8100
Sputtering Equipment

Photomask Blanks



EC7700
スパッタリング装置
EC7700
Sputtering Equipment



CANON ANELVA CORPORATION